



(4,000円)

特許願(3)(後記号ナシ)

昭和50年7月21日

特許庁長官 斎藤英雄殿

1. 発明の名称

シクロヘキサン誘導体の製造法

2. 発明者

住所 福岡県福岡市東区吉富町大字広津1336

氏名 津田豊

(ほか4名)

3. 特許出願人

住所 大阪市東区平野町3丁目35番地

名称 吉富製薬株式会社
(672)

代表者 田坂元祐

4. 代理人

住所 大阪市東区平野町3丁目35番地

吉富製薬株式会社内

氏名 弁理士(6630)高宮城勝

5. 添付書類の目録

(1) 明細書 1通

(2) 委任状 1通

(3) 特許願副本 1通



50 089539

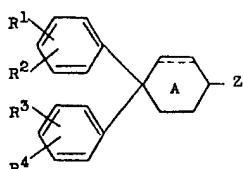
明細書

1. 発明の名称

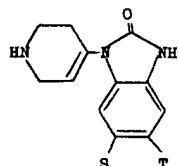
シクロヘキサン誘導体の製造法

2. 特許請求の範囲

一般式



で表わされる化合物と、一般式



で表わされる化合物とを反応させることを特徴とする、一般式

以下余白

⑯ 日本国特許庁

公開特許公報

⑪特開昭 52-14776

⑬公開日 昭52.(1977)2.3

⑭特願昭 50-89539

⑮出願日 昭50.(1975)7.21

審査請求 未請求 (全5頁)

府内整理番号 5921 44

7169 44 5921 44

6617 44 5921 44

5921 44 5921 44

⑯日本分類

16 E431.1

30 G133.31

30 H11/1

30 H11/1.5

30 H23.5

30 H321.31

30 H321.5

⑮Int.Cl²

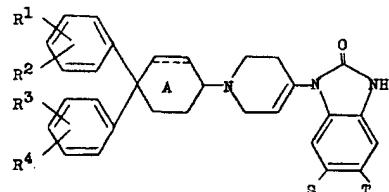
C07D401/04//

A61K 31/44

(C07D401/04

C07D211/58

C07D235/26)



で表わされる化合物並びにその塩の製造法。

上記式中、R¹, R², R³, R⁴は同一または異なつて、水素、ハロゲン、トリフルオロメチル、低級アルキル、低級アルコキシ、水酸基、メチレンジオキシを示す。

環Aの点線は、この部分が二重結合を形成してもよいことを示す。

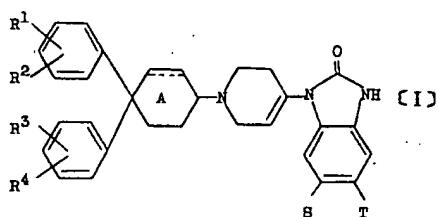
S, Tは同一または異なつて、水素、ハロゲン、トリフルオロメチル、低級アルキルを示す。Zは反応性活性エステル基を示す。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、中枢神経抑制作用、鎮痛作用、鎮痙

本発明によれば、前記一般式 [I] の化合物は、

医薬として有用な、一般式 [I]



[式中の R^1, R^2, R^3, R^4 は同一または異なつて、水素、ハロゲン、トリフルオロメチル、低級アルキル、低級アルコキシ、水酸基、メチレンジオキシを、S, T は同一または異なつて、水素、ハロゲン、トリフルオロメチル、低級アルキルを示す。環 A の点線は、この部分が二重結合を形成してもよいことを示す。]

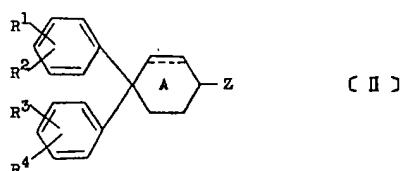
で表わされる新規なシクロヘキサン誘導体および医薬的に許容しうるそれらの塩の製造法に関するものである。

- 3 -

で表わされる化合物とを反応させることにより製造される。

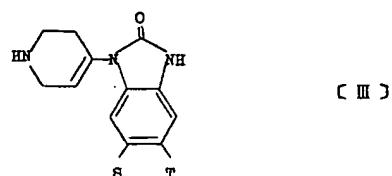
反応は、適当かつ不活性な希釈剤の存在下、または不存在下に実施されうるが、好ましくは、希釈剤を使用するのが良い。希釈剤としてメタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノールなどのアルコール系溶媒、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル系溶媒、メチレンクロライド、クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化炭化水素系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキサイド、ヘキサメチルホスホルアミド(HMPA)、N-メチルピロリドンなどの非プロトン性極性溶媒などが

一般式 [II]



[式中の R^1, R^2, R^3, R^4 および環 A の点線は前記のものと同義であり、Z は反応性活性エステル基、たとえば、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子、メチルスルホニルオキシ、パラトリルスルホニルオキシなどの有機スルホニルオキシを示す。]

で表わされる化合物と一般式 [III]



[式中の S, T は前記のものと同義である。]

- 4 -

使用されうる。更に反応を円滑にするため、副生する酸を除去するために適当な脱酸剤を使用するのが好ましい。脱酸剤として、無機塩基、有機塩基のいずれも使用することが出来る。無機塩基として、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどが使用される。有機塩基として、アルカリ金属アルコキサイド、たとえば、ソジクムメチラート、ソジクムエチラート、ソジクムターシヤリーブチレート、ポタシウムターシヤリーブチレートなど、酢酸ソーダ、酢酸カリ、トリエチルアミン、ビリジンなどが使用される。反応温度は 10~200°C で、一般に希釈剤を使用しないと 100~200°C の高温になる。反応時間は、使用する希釈剤、反応温度によつて異なるが、

30分～72時間である。好適には、40～60℃

で0.5～72時間である。

本発明によれば、一般式【I】の化合物において、環Aがシクロヘキセン環である場合には、不整旋光性が生じ、通常光学的に不活性なラセミ体が得られる。このラセミ体は通常よく知られた方法により光学活性体に分割することが出来る。

上記方法で、製造された一般式【I】の塩基は医薬的に許容されうる酸付加塩および四級塩にすることが出来る。塩を形成するための酸として、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸などの無機酸類およびマレイン酸、フマール酸、コハク酸、クエン酸、酒石酸などの有機酸類から適宜選択することが出来る。四級塩化剤としては、ジメチル硫酸、ジエチル硫酸、メチルアイオダイド、エチルプロマイドなどがあげられる。

- 7 -

これを塩基にもどすと固化する。アセトニーメタノールの混合溶媒より再結晶すれば、融点200～202℃の新規化合物1,4-ビス(4-フルオロフェニル)-4-[4-(2-オキソベンズイミダゾリン-1-イル)]-1,2,5,6-テトラヒドロピリジルシクロ-2-ヘキセンが白色結晶として得られる。

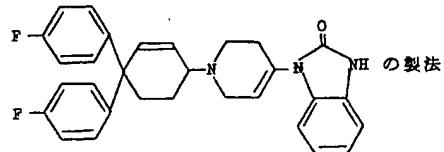
尚、原料として使用した1,4-ビス(4-フルオロフェニル)シクロ-2-ヘキセニルクロライドは新規化合物であり、以下のようにして開製する。

1,4-ビス(4-フルオロフェニル)シクロ-2-ヘキセノン(沸点170～180℃/0.2～0.3mmHg、融点67～68℃)5.7gをメタノール50mlに溶かし、水冷攪拌下、ソディウムボロヒドリッド0.8gを少量ずつ加えていく。その後室温にて2時間攪拌し、

以下実施例をあげて本発明の製造法を具体的に

説明する。

実施例1.



1,4-ビス(4-フルオロフェニル)シクロ-2-ヘキセニルクロライド6.1g、4-(2-オキソベンズイミダゾリン-1-イル)-1,2,5,6-テトラヒドロピリジン4.4g、炭酸カリウム3.3g、ジメチルホルムアミド50mlの混合物を55～60℃で1時間攪拌する。水にあけ、クロロホルムにて抽出し、水洗後、芒硝乾燥する。溶媒留去後、得られた油を、シリカゲルカラムクロマト(展開溶媒クロロホルム-メタノール(9:1))で分離精製する。精製物を常法により塩酸塩とし、

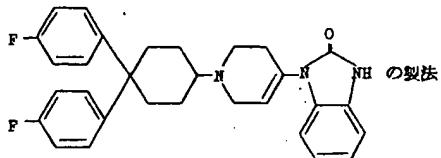
- 8 -

減圧下メタノールを留去する。残渣に水を加え、クロロホルム抽出し、常法処理後、得られた油を一夜放置すると固化する。これをヘキサン-イソブロビルエーテルから再結晶すれば、融点65～67℃の新規化合物1,4-ビス(4-フルオロフェニル)シクロ-2-ヘキセノールが白色結晶として得られる。次いで五塩化リン5gをベンゼン20mlに懸滴させた溶液を室温にて攪拌下、1,4-ビス(4-フルオロフェニル)シクロ-2-ヘキセノール6gをベンゼン20mlに溶かした溶液を徐々に滴加する。全量滴加後、1時間室温にて攪拌し、次いで、これを氷水中にあける。ベンゼンにて抽出し、水洗、芒硝乾燥後、溶媒留去する。得られた油をヘキサン-石油エーテルから結晶化させ、この溶媒にて再結晶すれば、融点39～42℃の新規化合物1,4-ビス(4-フルオロフェニル)

ムの混合溶媒から再結晶すれば、融点235~

ル) シクロ-2-ヘキセニルクロライドが白色結晶として得られる。

実施例2

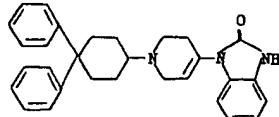


4,4'-ビス(4-フルオロフェニル)シクロヘキサノール・トシレート 17.7g、4-(2-オキソベンズイミダゾリン-1-イル)-1,2,5,6-テトラヒドロピリジン 8.6g、炭酸カリウム 5.6g、ジメチルホルムアミド 100mLの混合物を 65~70°Cで88時間攪拌する。水にあけ、クロロホルムにて抽出し、常法処理後、得られた油をシリカゲルカラムクロマト(展開溶媒クロロホルム-メタノール(9:1))で分離精製する。得られた精製物(結晶)をメタノール-クロロホルム

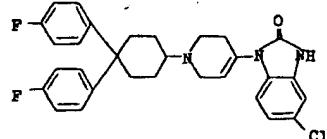
238°Cの新規化合物 1,1-ビス(4-フルオロフェニル)-4-[4-(2-オキソベンズイミダゾリン-1-イル)-1,2,5,6-テトラヒドロピリジル]シクロヘキサンが白色結晶として得られる。

実施例1,2と同様にして、たとえば次の化合物を製造することが出来る。

〔I〕

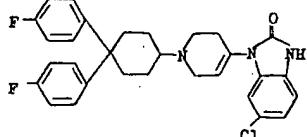


〔II〕

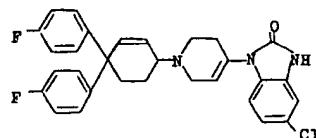


- 11 -

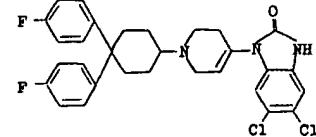
〔III〕



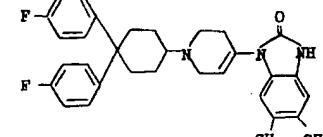
〔IV〕



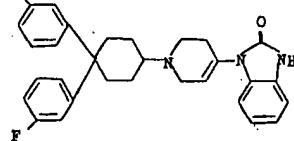
〔V〕



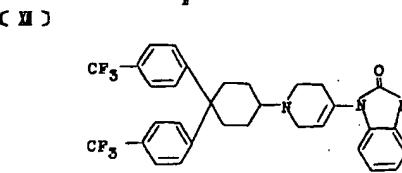
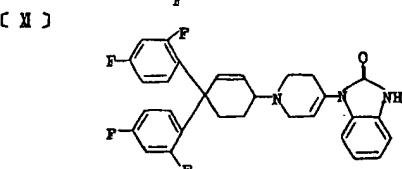
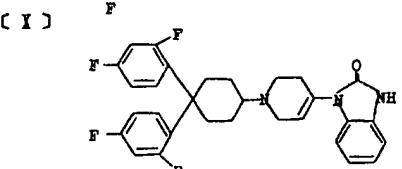
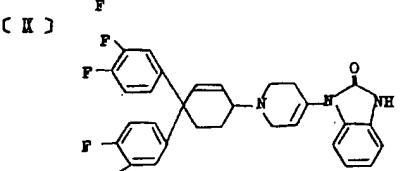
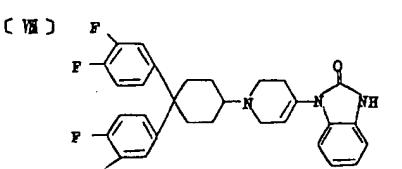
〔VI〕



〔VII〕



- 12 -

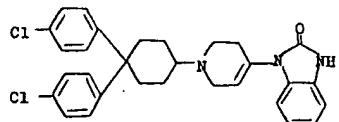


- 13 -

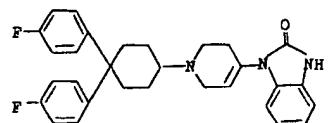
-620-

- 14 -

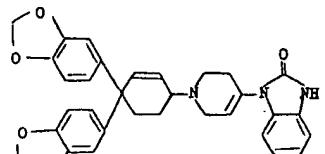
(XIII)



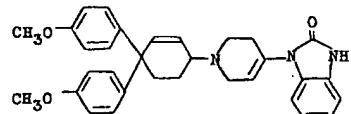
(XIV)



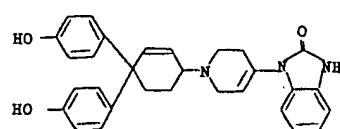
(XV)



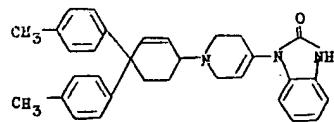
(XVI)



(XVII)



(XVIII)



代理人 奥里士 高宮城



- 15 -

- 16 -

6. 前記以外の発明者

住所 大分県中津市中央町2丁目5の20

氏名 有田 雅文

住所 大分県中津市官夫深町172の19

氏名 浜崎 崇勇

住所 大分県中津市大字万田566番地の7

氏名 津留 立身

住所 福岡県筑上郡吉富町大字広津1336

氏名 笹寅 篤徳